

05; 06; 12

© 1990 г.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАГНИТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА
НА ОСНОВЕ ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ**

*Н. А. Логинов, М. В. Михайленко, В. В. Рандошкин,
В. Д. Троицко, Н. В. Шиманская, В. И. Чани*

Проведены исследования динамических свойств магнитооптических модуляторов, изготовленных из Bi-содержащих монокристаллических пленок феррит-гранатов. Определено время перехода доменной структуры в новое состояние равновесия для нескольких конкретных образцов в присутствии постоянного магнитного поля в плоскости пленки, что позволяет значительно расширить динамический диапазон магнитооптических модуляторов.

Основные требования к магнитным материалам, используемым в фарадеевских модуляторах, сводятся к следующему: материал должен обладать как можно более высокими значениями магнитооптической (МО) добротности ϕ , подвижности доменных стенок (ДС) v_p и предельной скорости движения ДС v_p , а также малыми значениями поля насыщения $H_{\text{нас}}$ и равновесной ширины доменов W_0 в отсутствие внешнего магнитного поля [1]. Последние два требования противоречивы, поскольку снижение W_0 , как правило, достигается увеличением намагниченности насыщения $4\pi M$ и, следовательно, ростом $H_{\text{нас}}$. Высокую МО добротность в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах можно получить в висмутсодержащих монокристаллических пленках феррит-гранатов (МПФГ), выращиваемых методом жидкофазной эпитаксии на подложках из немагнитных гаранатов [2, 3], что обуславливает перспективность использования этих материалов в фарадеевских модуляторах.

Настоящая работа посвящена исследованию динамических свойств МО модуляторов, изготовленных на основе Bi-содержащих МПФГ. Принцип действия модуляторов основан на движении ДС под действием импульсного магнитного поля H_i , приложенного перпендикулярно плоскости пленки. В эксперименте измеряли время перехода ДС в новое состояние равновесия τ_ϕ после приложения импульса магнитного поля. Изучалось также влияние на τ_ϕ постоянных магнитных полей: $H_{\text{см}}$, приложенного перпендикулярно плоскости пленки, и $H_{\text{пп}}$, приложенного в плоскости пленки. Если поля $H_{\text{см}}$ и H_i приложены в одном направлении, то увеличение $H_{\text{см}}$ приводит к уменьшению ширины «невыгодно» намагниченных доменов, а также снижению за счет этого τ_ϕ и одновременному уменьшению величины глубины модуляции. При уменьшении $H_{\text{см}}$ глубина модуляции растет, но увеличивается τ_ϕ . Приложение $H_{\text{пп}}$, вообще говоря, приводит к росту v_p [4], что должно способствовать уменьшению τ_ϕ .

В процессе исследований регистрировали интегральные характеристики импульсного перемагничивания [5, 6] на установке, позволяющей создать с помощью катушек Гельмгольца диаметром 2 мм импульсы магнитного поля амплитудой до 40 кА/м и длительностью 200 нс, при длительности фронта импульса ~5 нс. Результаты измерений усреднялись по площади образца, так как в поле зрения попадало несколько доменов (с учетом дефектности из расчета не менее 1 дефекта на 5 мм^2). Для регистрации фотоотклика МО системы на импульс-

Состав	h , мкм	W_0 , мкм	$4\pi M$, Гс	H_k , кА/м	$H_{\text{нас}}$, кА/м	T_N , °C	$\Theta_F \cdot 10^3$, град/см	μ , см/с · Э	$\gamma \cdot 10^{-7}$, Э · с	K , мкм/Э
<i>A</i>	9.64	7.76	278.6	310.4	12.7	185	16.8	10000	1.79	0.078
<i>B</i>	6.54	8.41	160.7	184.7	5.3	136	6.96	300	1.09	0.120
<i>V</i>	7.58	8.51	105.4	120.2	3.9	161	2.70	900	4.03	0.107

магнитного поля использовали ФЭУ-79 с усилителем, обеспечивающим полосу рабочих частот 40 МГц.

В модуляторе использовали МПФГ составов $(\text{BiY})_3(\text{FeGa})_5\text{O}_{12}$ (*A*) [7], $(\text{BiTm})_3(\text{FeGa})_5\text{O}_{12}$ (*B*) [8] и $(\text{BiGdTm})_3(\text{FeGa})_5\text{O}_{12}$ (*B*) [9] с ориентацией (111). При выборе МПФГ руководствовались следующими соображениями. Пленки состава *A* не содержали в своем составе быстрорелаксирующих ионов и обла-

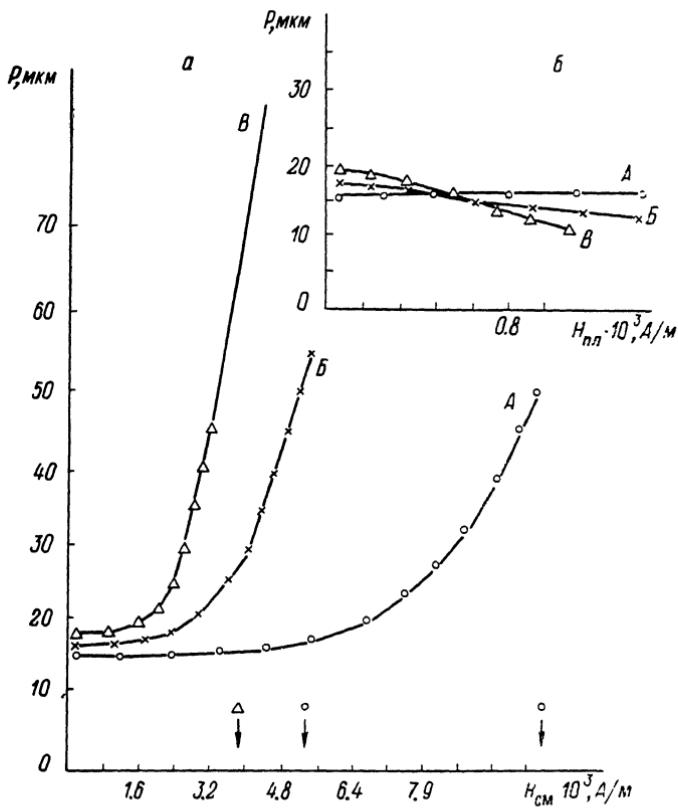


Рис. 1. Зависимости периода доменной структуры P для МПФГ составов *A*, *B*, *V* от величины постоянного магнитного поля $H_{\text{см}}$ (а) и постоянного магнитного поля $H_{\text{пл}}$ (б).

дали вследствие этого большим значением μ . МПФГ составов *A* и *B* имели низкие значения $4\pi M$ и, следовательно, малые значения $H_{\text{нас}}$. Пленки состава *V* обладали высокой скоростью v_p из-за аномально высокого эффективного значения гиromагнитного отношения γ , а пленки состава *B*, наоборот, пониженным значением γ .

Некоторые параметры исследованных МПФГ приведены в таблице, где h — толщина пленки, $4\pi M$ — намагниченность насыщения, H_k — поле одноосной анизотропии, T_N — температура Нееля, Q_F — удельное фарадеевское вращение на длине волны $\lambda=0.633$ мкм, K — коэффициент жесткости ДС.

На рис. 1, а показаны зависимости периода доменной структуры от $H_{\text{см}}$. Стрелками показаны значения $H_{\text{нас}}$. При достаточно большой длительности

импульса модулирующего поля τ_u его амплитуда должна выбираться из условия $H_u + H_{\text{см}} < H_{\text{нас}}$, поскольку в противном случае будет наблюдаться задержка спада импульса из-за намагничивания образца до насыщения [4]. Если же важным является повышение быстродействия за счет увеличения скорости ДС при увеличении H_u , то длительность модулирующего импульса должна удовлетворять условию $\tau_u < W/2v$, где W — ширина домена, v — скорость движения ДС. Скорость движения ДС в исследованных МПФГ измеряли методом высокоскоростной фотографии. При достаточно больших H_u значение v определяли так же, как в [9], т. е. путем регистрации временной зависимости смещения ДС домена с обратной намагченностью при перемагничивании МПФГ из насыщенного состояния. При этом продвигающее поле равно $H = H_u - H_{\text{см}}$. При значениях поля H_u , не достаточных для зарождения доменов с обратной намагченностью при импульсном перемагничивании МПФГ из насыщенного состояния, для определения v регистрировали зависимость смещения ДС ЦМД от времени, по начальному наклону которой находили v . При этом действующее поле равно H_u .

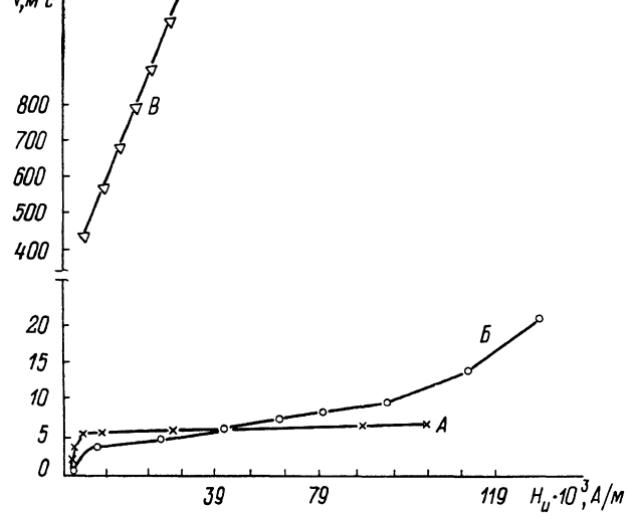


Рис. 2. Зависимость скорости движения ДС v от амплитуды импульсного магнитного поля H_u для МПФГ составов А, Б, В.

В процессе работы модулятора действующее поле H в начальный момент времени после приложения импульса поля равно H_u , а по мере продвижения ДС оно уменьшается. Типичные зависимости $v(H)$ приведены на рис. 2 для пленок трех исследуемых составов. Обнаружено, что для МПФГ составов А и Б наблюдается насыщение скорости движения ДС, тогда как для МПФГ состава В зависимость $v(H)$ линейная, т. е. v не достигает уокеровского предела. Из этих зависимостей видно, что при постоянной глубине модуляции зависимость $\tau_\phi(H_u)$ должна быть ярче выражена в МПФГ состава В.

На рис. 1, б приведены зависимости периода полосовых доменов P от величины магнитного поля $H_{\text{пп}}$, приложенного в плоскости пленки. Видно, что $H_{\text{пп}}$ оказывает слабое влияние на P , что обусловлено высоким значением поля одноосной анизотропии H_k (см. таблицу); самая сильная зависимость $P(H_{\text{пп}})$ наблюдается в образце В, обладающем минимальным значением H_k . Тем не менее уменьшение P с ростом $H_{\text{пп}}$ при прочих равных условиях должно приводить к некоторому уменьшению τ_ϕ .

Известно, что при малых значениях H_u в первом приближении соблюдается прямопропорциональная зависимость между величиной смещения ДС X и величиной H_u [10]

$$X = kH_u, \quad (1)$$

где k — коэффициент жесткости ДС.

Поскольку действующее на ДС поле меняется в процессе ее движения, то меняется, вообще говоря, и скорость движения ДС. В образце *B*, где зависимость $v(H_n)$ линейна, средняя скорость ДС равна

$$v_{op} = \mu H_n / 2 = v_0 / 2, \quad (2)$$

где v_0 — начальная скорость движения ДС после приложения импульса поля H_n , причем v_0 не зависит от H_n . В этом случае время перехода ДС в новое состояние равновесия после приложения импульса поля или, другими словами, длительность фронта импульса фотоотклика будет иметь следующий вид:

$$\tau_\phi \approx X/v_{op} \approx 2k/\mu, \quad (3)$$

где τ_ϕ не зависит от H_n , что и подтверждается экспериментальными зависимостями $\tau_\phi(H_n)$ (рис. 3, *a*). При относительно больших значениях H_n зависимость $x(H_n)$ перестает быть линейной, причем ее наклон с ростом H_n уменьшается, что и

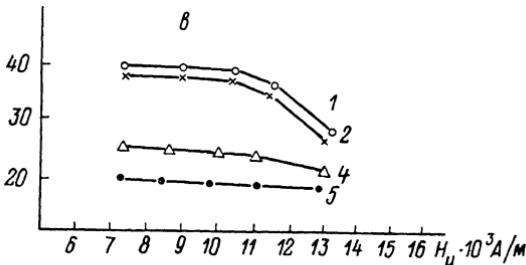
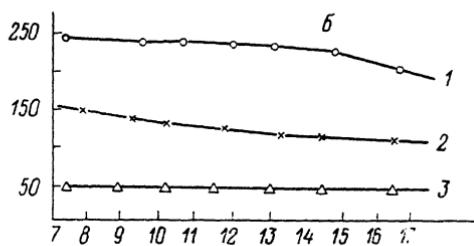
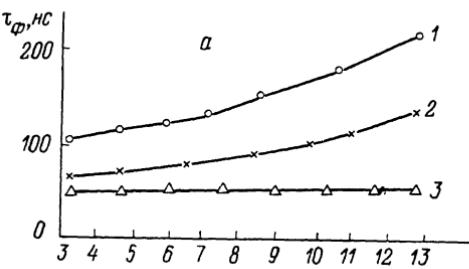


Рис. 3. Зависимость времени перехода ДС в новое состояние равновесия τ_ϕ от амплитуды импульсного магнитного поля H_n для МПГФ составов *A* (*a*), *B* (*b*), *B* (*c*) при наличии постоянного магнитного поля.

H_{pk} , кА/м: 1 — 0, 2 — 12.5, 3 — 35, 4 — 50, 5 — 100.

приводит к снижению τ_ϕ при превышении значения 10 кА/м (рис. 3, *c*, зависимости 1, 2, 3). Как следует из формулы (3), для дальнейшего снижения τ_ϕ , определяющего быстродействие при модуляции, в таких материалах целесообразны снижение параметра затухания α и увеличение подвижности μ .

В образце системы *A*, где v_0 практически не зависит от H_n (за исключением значений начального участка для значений поля $H_n < v_0/\mu < 10^2$ А/м), средняя скорость ДС практически не зависит от H_n . В связи с этим τ_ϕ должно увеличиваться с ростом H_n по закону, близкому к линейному, что и подтверждается экспериментом (рис. 3, *a*, зависимость 1). Значение параметра затухания α и подвижности ДС μ при этом не оказывает влияния на τ_ϕ , что связано с ранним насыщением скорости ДС. Присутствие H_{pk} повышает предельную скорость движения ДС [7], препятствуя динамическому преобразованию доменной структуры, которое приводит к расширению ДС и росту за счет этого ее инерционных свойств; поэтому τ_ϕ уменьшается с ростом H_{pk} (рис. 3, *a*, зависимости 2—3; рис. 4, *a*). Например, уменьшение значения τ_ϕ почти на порядок при $H_n = 12.9$ кА/м достигнуто при приложении поля $H_{pk} \sim 40$ кА/м (рис. 4, *a*).

Образец *B* по своим свойствам (параметры α , μ) занимает промежуточное положение между образцами *A* и *B*. Отличие его состоит в том, что начальная подвижность его ниже, чем в образце *A* и близка к значению μ для образца *B* (см. таблицу). Кроме того, в полях $H_n \geq 10$ кА/м значение v_0 в этом образце сильнее зависит от H_n , чем в образце *A*. Исходя из этого, зависимость $\tau_\phi(H_n)$ для образца *B* выражена слабее (рис. 3, *b*) по сравнению с образцом *A*, хотя

качественно эти зависимости, так же как зависимости $\tau_\phi(H_{\text{пл}})$ (рис. 4, а, б), совпадают.

В работе экспериментально показано, что в МПФГ состава В время перехода ДС в новое состояние равновесия в отсутствие $H_{\text{пл}}$ составляет около 20 нс, что обеспечивает предельную частоту модуляции $F_{\text{пп}} \approx 10-20$ МГц при использовании этих пленок в модуляторе при достаточно высокой глубине модуляции. Для МПФГ составов А и Б $F_{\text{пп}}$ в аналогичных условиях на порядок ниже, однако ее

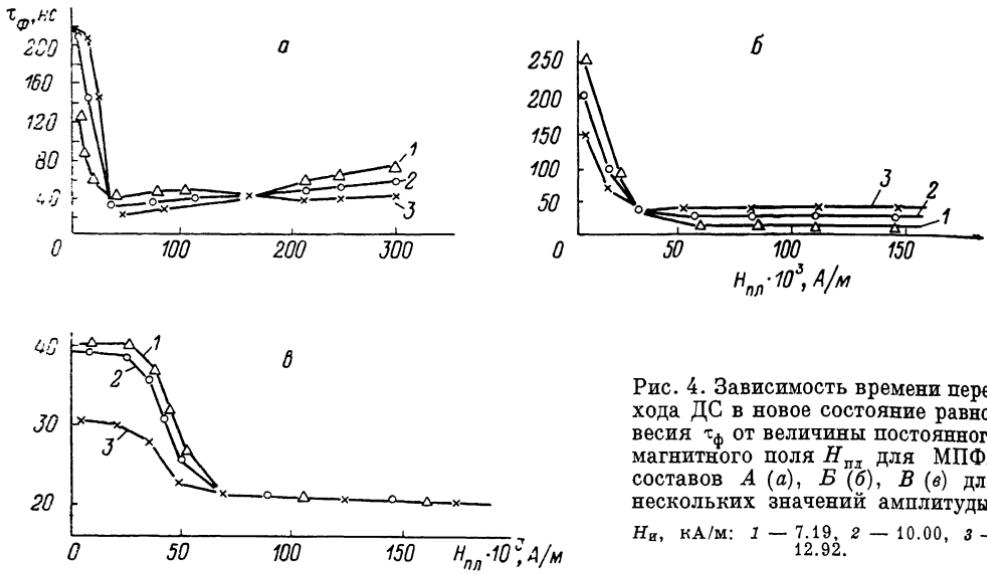


Рис. 4. Зависимость времени перехода ДС в новое состояние равновесия τ_ϕ от величины постоянного магнитного поля $H_{\text{пл}}$ для МПФГ составов А (а), Б (б), В (в) для нескольких значений амплитуды.

$H_{\text{и}}, \text{ кА/м: } 1 - 7.19, 2 - 10.00, 3 - 12.92.$

можно значительно увеличить, прикладывая постоянное поле в плоскости пленки. Таким образом, учитывая параметры МПФГ и подбирая конкретные значения $H_{\text{пл}}$ для каждой конкретной пленки, можно оптимальным образом использовать возможности ее с точки зрения сочетания максимальной чувствительности и высоких динамических и МО параметров, что необходимо при создании конкретных МО модуляционных устройств.

В заключение авторы благодарят М. В. Логунова, В. Б. Сигачева за помощь при проведении настоящей работы.

Список литературы

- [1] Балбашов А. М., Червоненкис А. Я. Магнитные материалы для микроэлектроники. М.: Энергия, 1979. 216 с.
- [2] Рандошкин В. В., Червоненкис А. Я. // Радиоэлектроника (состояние и тенденции развития). НИИЭИР. 1985. Ч. II. С. 78—90.
- [3] Рандошкин В. В., Червоненкис А. Я. // Радиотехника (состояние и тенденции развития). 1985. Ч. II. С. 80—70.
- [4] Рандошкин В. В., Иванов Л. П. // Телесная П. В. // ЖЭТФ. 1978. Т. 75. Вып. 3. С. 960—975.
- [5] Логунов М. В., Рандошкин В. В. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 6. С. 1199—1201.
- [6] Логунов В. В., Рандошкин В. В. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 6. С. 1987—1991.
- [7] Бахтеузов В. Е., Ким Т. А., Рандошкин В. В., Сигачев В. Ф., Червоненкис А. Л. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 6. С. 1227—1230.
- [8] Губарев А. П., Рандошкин В. В. и др. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 7. С. 1393—1399.
- [9] Рандошкин В. В., Сигачев В. Б. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 42. Вып. 1. С. 34—37.
- [10] Schröder E. // J. Appl. Phys. 1974. Vol. 45. P. 369.

Киевский
политехнический институт

Поступило в Редакцию
2 июня 1988 г.

В окончательной редакции
28 декабря 1989 г.